

Domaines d'application:

- La micro-structuration de surface
- L'électronique et la microélectronique
- La photolithographie
- La photochimie localisée

Caractéristiques:

- Système adaptable sur microscope optique standard
- Résolution de l'ordre du micron
- Utilisation du même masque pour une lithographie du centimètre au micron par homothétie
- Pas de nécessité de salle blanche
- Masques réalisables sur une imprimante laser
- Méthode simple, rapide et peu onéreuse

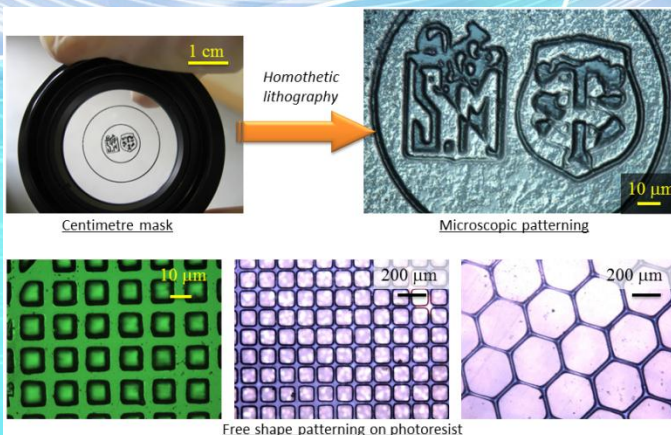
Procédé de lithographie homothétique

L'objet de la présente invention concerne un dispositif pour transformer un microscope optique standard en une machine capable de réaliser à faible coût de la photolithographie avec une résolution de l'ordre du micron. Les modifications du microscope permettent de reproduire une lithographie avec le même masque diminuant ainsi le coût et le temps de préparation, sans les impératifs de la salle blanche

Exemple d'application

Masque centimétrique placé dans le dispositif du microscope pour réaliser de la microstructuration.

Quelques exemples de motifs micrométriques réalisés sur une résine photosensible aux ultraviolets par ce procédé.



- "Device for homothetic projection of a pattern onto the surface of a sample, and lithography method using such a device", J. Polese, FR2966941, WO2012055833